

# 重庆真空镀膜 半导体光刻加工厂 IGZO真空镀膜

产品名称	重庆真空镀膜 半导体光刻加工厂 IGZO真空镀膜
公司名称	广东省科学院半导体研究所
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区长兴路363号
联系电话	15018420573 15018420573

## 产品详情

低压气相沉积真空镀膜加工厂——广东省科学院半导体研究所是广东省科学院下属骨干研究院所之一，主要聚焦半导体产业发展的应用技术研究，兼顾重大技术应用的基础研究，立足于广东省经济社会发展的实际需要，从事电子信息、半导体领域应用基础性、关键共性技术研究，以及行业应用技术开发。

化学气相沉积(CVD)是薄膜技术领域常用的成熟工艺。该工艺中，固体材料在气相态下，通过化学反应沉积到被加热的基材表面，形成一层薄膜。半导体研究院提供在电线和光纤等基材上沉积碳或氮化硅(SiC)材质的CVD工艺特殊解决方案。CVD镀膜是高温工艺，IGZO真空镀膜，要求温度在500 °C及以上，且能量输入极高。工艺腔室中的真空环境能够降低熔点，并在保障前驱体物质转化为气相态的同时，避免不必要的化学反应。与PVD工艺不同，化学气相沉积允许复杂形状及三维表面的膜层保形。该工艺也能够硅片表面制备极为精细的结构。

欢迎来电咨询半导体研究所哟~真空镀膜

低压气相沉积真空镀膜加工厂——广东省科学院半导体研究所是广东省科学院下属骨干研究院所之一，主要聚焦半导体产业发展的应用技术研究，重庆真空镀膜，兼顾重大技术应用的基础研究，立足于广东省经济社会发展的实际需要，从事电子信息、半导体领域应用基础性、关键共性技术研究，以及行业应用技术开发。

磁控溅射的生产工艺就是在真空的环境里采用电离子有序轰击镍、银、钛、金、钨、铜、铝等贵金属靶材，并采用磁场控制的方式让金属离子均匀的溅射到光学级的PET基材上，沉积成金属镀膜层。这些金属层会选择性的将阳光中的各种热能源，铁金属真空镀膜，包括红外线、紫外线及可见光热能反射回去。由于粒子更细、结构更紧密，因此，隔热持久性比传统热蒸发镀铝工艺更高，而且可以保证永不褪色。采用真空磁控溅射工艺制造出的玻璃膜有更持久和高效率的隔热性能、更高的清晰度，低反光和更自

然的金属原色。由于磁控溅射工艺属于反射隔热，所以车窗玻璃在长时间的阳光照射下也不会特别烫，这是区别于吸热型隔热膜的一大特点。

欢迎来电咨询半导体研究所哟~

低压气相沉积真空镀膜加工厂——广东省科学院半导体研究所是广东省科学院下属骨干研究院所之一，主要聚焦半导体产业发展的应用技术研究，兼顾重大技术应用的基础研究，立足于广东省经济社会发展的实际需要，从事电子信息、半导体领域应用基础性、关键共性技术研究，以及行业应用技术开发。

传统晶硅太阳能电池的生产工艺过程分别为清洗制绒、扩散、刻蚀、PECVD、丝网印刷和烧结等步骤，氧化锌真空镀膜，其中清洗制绒工艺将严重影响硅片表面的绒面的均一性。取两片清洗制绒后硅片，在同一条件下进行PECVD镀氮化硅膜，片1的表面均一性较差，片2的表面均一性良好，其绒面大小约 $2.13\ \mu\text{m}$ 。通过实验表明，通过PECVD沉积在片1表面的氮化硅薄膜产生了色差，即部分区域偏红，部分区域偏白。这是由于同一条件下，反应气体流量相同，比表面积大的区域沉积的氮化硅厚度越小，而比表面积小的区域则反之。相比之下，片2表面均一性较好且无色差，可见，硅片表面微观结构差异较大会造成比表面积明显差异，从而使氮化硅薄膜厚度产生显著差异，表现出不同颜色，即色差。

欢迎来电咨询半导体研究所哟~

重庆真空镀膜-半导体光刻加工厂-

IGZO真空镀膜由广东省科学院半导体研究所提供。广东省科学院半导体研究所是广东广州,电子、电工产品加工的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在半导体研究所领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创半导体研究所更加美好的未来。